

令和3年9月吉日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第172回研究会開催通知

日時： 2021年10月1日(金) 13:00～16:55

場所： オンライン開催

テーマ： 「先端 GaN 系発光デバイスの開発最前線—材料・プロセス技術」

世話人： 三宅秀人(三重大)、酒井 朗(大阪大)、上田 修(明治大)

プログラム：

- | | | |
|-------------|--|------------|
| 13:00～13:05 | 開会の挨拶 | 柿本 浩一(九州大) |
| 13:05～13:10 | はじめに | 三宅 秀人(三重大) |
| 13:10～13:50 | 「GaN ナノワイヤ・量子殻の作製と半導体レーザーへの応用」 | 上山 智(名城大) |
| 13:50～14:30 | 「緩和した中間 Al 組成 AlGa _N を用いた UV-B レーザの作製」
岩谷素顕、竹内哲也、上山智(名城大)、三宅秀人(三重大) | |
| 14:30～15:10 | 「AlN 基板上 UV-C LD のプロセス起因劣化」 | 笹岡千秋(名古屋大) |
| 15:10～15:30 | 休憩 | |
| 15:30～16:10 | 「極性基板および半極性 GaN 基板を用いた窒化物面発光レーザー」
仲山英次、濱口 達史、林賢太郎、ジャレットカーンズ、保科幸男、
條川達郎、大原真穂、小林紀子、牧野智大、長根昭悦、伊藤まいこ、
川西秀和、幸田倫太郎、風田川統之(ソニーグループ株式会社) | |
| 16:10～16:50 | 「AlInN/GaN DBR を用いた青色および緑色 GaN 系 VCSEL の開発」
寺尾 顕一、長井仁史、森田大介、柘井真吾、柳本友弥、長濱慎一
(日亜化学工業株式会社) | |
| 16:50～16:55 | おわりに | 酒井 朗(大阪大) |